

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与机构名称	财通基金、海富通基金、国海证券
时间	2026年3月12日
地点	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋
公司接待人员姓名	董事会秘书 庄丽华 投资者关系专员 郝一骏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下公司的业务情况及产品情况</p> <p>回答：公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务，并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。公司主要产品等离子体射频电源系统（等离子体射频电源及匹配器）被广泛应用于半导体工艺中的薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等环节，且直接决定设备工艺能力、产品良率。历经十年，公司先后推出 CSL、Bestda、Aspen 三代产品系列等离子体射频电源系统，成功打破了美系两大巨头在国内长达数十年的垄断格局，填补国内空白。公司研发的新一代等离子体射频电源系统Cedar系列产品，锚定更先进制程前沿领域，目前处于验证阶段。</p> <p>2. 请介绍一下公司核心技术优势</p> <p>回答：经过十多年的持续研发、不断创新和积累，公司以技术发展、行业需求为双导向，建立了“基石技术+产品化支撑技术”的技术体系，一方面从测量、控制及架构三方面构建的底层通用的 3 大基石技术，并基于基石技术，结合半导体设备中应用，特别是先进制程中更快速、更精准、更稳定的应用诉求和实现难点，发展出 8 大产品化支撑技术，实现了突破高端等离子体射频电源系统的先进设计、测量和控制等难题，掌握了信号采样及处理、相位同步锁定、快速调频、脉冲控制等等离子体射频电源系统运行中的关键技术。频快速响应能够使等离子体在最短时间内达到稳定状态，实现对薄</p>

膜厚度和膜厚均匀性的精准控制，是设备运行的稳定性和产品良率的关键。公司产品等离子体射频电源系统作为薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶和键合环节生产设备的核心零部件，是半导体制造中等离子体工艺控制的核心。同时，等离子体射频电源系统也是半导体设备零部件国产化最难环节之一，在此严苛要求下，公司已具备成熟的规模化量产能力，公司产品已量产交付拓荆科技、中微公司、北方华创、微导纳米、盛美上海等国内头部半导体设备商，并成为薄膜沉积、刻蚀环节国内头部设备商的战略级供应商。

3. 请介绍一下公司人员情况

回答：截止2025年6月30日，公司员工人数达375人。其中，生产人员占比约28%，管理及其他职能人员占比约26%，销售人员占比约4%，研发人员占比约42%，员工总数及研发人员数量均保持高速增长。公司核心技术人员均具有15年以上的从业经验，主要研发骨干也拥有5年以上的从业经验，在等离子体射频电源系统领域有着深厚的经验积淀，能够较好地把握下游设备厂商的国产化需求以及行业发展趋势，公司将持续增加研发投入，同时加强生产、销售、技术支持等团队的建设与管理。

4. 请介绍一下公司员工培养的机制

回答：公司不断加强人才梯队建设工作，通过各种方式重点激励研发人才。公司还将持续引进各类专业人才，包括招募更多具备前瞻性、共性基础技术研究能力的技术人才，尤其是国内外高端专业技术人才、各领域高端管理人才的引进，不断优化人才结构。公司将坚持内部培养和外部招聘相结合的战略方针，加大人力资源成本投入，包括加大与高校科研院所合作与联合培养等，吸引更多优秀人才，打造一流的人才队伍，满足公司快速发展的需要。

5. 请介绍一下董事长乐卫平的创业历程

回答：乐卫平先生于1995年7月至2002年2月就职于湖南省桃源县邮电局电信设备厂，任技术员、工程师；2003年3月至2006年5月，就职于AE（深圳），任测试技术员、工程师；2006年6月至2014年4月，就职于AE（上海），任产品应用工程师与销售高级经理；2014年5月至2021年9月，就职于公司，任执行董事、总经理；2021年9月至今，任公司董事长、总经理。公司于2013年成立，早期以引进真空装备核心零部件业务为主，自研产品上处于起步探索期。2018年公司进入快速发展期，公司自研产品在半导体领域的应用取得重大突破，实现了半导体级等离子体射频电源系统的技术突破，研制出Bestda系列等离子体射频电源系统实现设备商验证并批量出货。2023年公司进入持续创新期，公司自研产品已成为业务主导。此外，公司持续为晶圆厂提供等离子体射频电源系统原位替换及维修服务。同时，公司在此阶段突破了先进制程的技术难题，研发出Aspen/Basalt系列等离子体射频电源系统，完成了产品代际升级，应用的设备工艺阶段也从薄膜沉积扩展至刻蚀的批量应用；同时，Torrent系列远程等离子体源和Ginkgo系列等离子体直流电源等产品也陆续完成开发，实现部分小批量交付，进一步丰富了公司的产品种类。在此阶段，公司还突破了等离子体电弧检测与控制、等离子体偏置电压的脉冲控制等先进技术，公司进入快速上升通道，业务规模持续扩大。公司始终致力于成为围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案的平台型公司。

6. 请介绍一下公司的募投项目情况。

回答：“沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目”主要开展半导体级等离子体射频电源系统产品的生产和销售，统筹区域内优势资源，健全总部与子公司之间的分工合作机制。“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”拟提升公司等离子体射频电源系统、等离子体直流电源、等离子体激发装置等产品的生产规模和生产效率。同时，该项目将建设信息化业务管理平台，旨在实现公司生产自动化和业务管理信息化、数字化。本项目建成后，将能够提升公司相关产品的生产服务能力，以及在业务规划、经营决策等方面整体提升公司的信息化管理能力。“研发与前沿技术创新中心项目”拟进行下一代等离子体射频电源及匹配器、电源类新品、质量流量计、等离子体设备相关衍生产品等产品及技术的研究。“营销及技术支持中心项目”通过在长三角地区、珠三角地区、京津冀地区、中西部地区等关键区域建立营销及技术支持中心，能够直接与终端晶圆厂沟通并获取实时的技术反馈，为客户提供更加精准和定制化的技术服务，并且能够直接参与到与终端晶圆厂的合作，第一时间获悉先进制程对核心零部件的最新技术要求，从而提升整体的生产效率和产品的市场适应性，从而巩固并扩大市场份额。除此之外，公司将通过沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目及半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目提高产品生产效率，扩大公司产销规模，满足不断增长的市场需求并解决公司产能瓶颈问题，提升公司整体运营效率，促进公司业绩增长。以上募投项目的建设，将进一步提高公司产品产能，加快推进公司核心技术的商业化落地，满足下游客户高速增长的市场需求。同时提高公司整体创新水平，提升公司智能化生产能力、技术服务能力和响应速度，从而提升公司综合竞争力，推动公司主营业务高质量发展。

7. 公司2026年一季度的业绩情况如何？

回答：公司2026年一季度的业绩情况以公司最终在官方渠道所披露的2026年一季报为准。

以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。